



新聞稿

EV Group 透過次世代 EVG150 光阻製程平台 擴大在光學微影領域的領先優勢

*經重新設計的 200 毫米平台提升模組數量以達到更高的製程產出，
透過架構改善降低設備的佔地面積，同時維持前一代平台引領業界的功能*

台北，2022 年 11 月 10 日 — 微機電系統 (MEMS)、奈米科技與半導體市場的晶圓接合暨微影技術設備領導廠商 EV Group (EVG)，今天宣布發表次世代 200 毫米版本的 EVG[®]150 自動化光阻製程系統，強化該公司的光學微影解決方案產品組合。重新設計的 EVG150 平台包括先進功能與強化項目，與前一代平台相比可提供更高的製程產出（最多高出 80%）、通用性，以及更小的設備佔地面積（減少近 50%）。EVG150 在通用的平台上提供可靠且高品質的塗佈與顯影製程，可支援各種裝置與應用，包括先進封裝、微機電系統、無線射頻 (RF)、3D 感測、功率元件以及光子元件。EVG150 極高的製程產出、彈性與再現性，能支援大規模量產與工業開發所需的最嚴苛需求。

電子控制系統 (EBS) 產業的頂尖研究中心 Silicon Austria Labs 是第一個採用次世代 EVG150 系統的客戶。Silicon Austria Labs 微系統研究部門負責人 Mohssen Moridi 博士表示：「早在工業 4.0、物聯網、自動駕駛、虛實整合系統 (CPS)、人工智慧、智慧城市、智慧能源與智慧醫療問市前，我們就透過與引領業界的製造商共同研究，開發出奠定上述應用基礎的關鍵技術。EVG 的次世代 EVG150 光阻製程系統的高度彈性，為我們客戶的全新製程與產品的大規模導入打好基礎，並推動 EBS 的創新。」

通用平台提供前所未見的彈性

為 200 毫米基板設計的次世代 EVG150 保有前一代平台引領業界的功能，包括具有全自動化功能的可客製化的旋轉與噴霧式塗佈、顯影、烘烤與冷卻模組；EVG 專有的 OmniSpray[®]技術，可因應極端形貌的成形塗佈；精密且經現場驗證的機械化處理，具雙末端執行器可確保持續的高製程產出；以及晶圓邊緣、弓形、翹曲及薄化晶圓的處理。

次世代 EVG150 200 毫米平台的全新功能包括：

- 最多達四個溼式製程模組的空間，以及高達 20 個烘烤/冷卻單元，可以同時處理更多的晶圓。
- 獨立的光阻塗佈腔體使模組間完全隔離，幾乎完全消除模組間的交互污染。
- 模組經過進一步重新設計，可從設備外部更容易處理個別的腔體，獲得最小的停機時間，且在進行腔體保養時也可持續操作設備。



- 系統內部的腔體經重新定義，以便更容易以機械化處理來進行保養。
- 具有影像功能的預對準系統，可以隨時進行晶圓置中進而加速製程。
- 整合系統內部的光阻與化學藥液管線，可以減少儲存化學藥液的外部機櫃空間，並降低設備的佔地面積。
- 將使用者介面整合於系統內，可以進一步降低設備的佔地面積。

EV Group 企業技術總監 Thomas Glinsner 博士表示：「光阻製程與圖形化是半導體製造中反覆進行最多次的製程步驟。EVG 已經針對這些製程累積了多年的經驗，包括光學微影、旋轉與噴霧式塗佈，以滿足最嚴苛的客戶需求。我們將這些經驗融入到次世代的 EVG150 系統中，這套系統經全面性的重新設計，可在通用平台上提供突破性的製程產出與擁有成本效益，提供無與倫比的彈性，以滿足最廣泛的光阻製程需求。」

產品供應時程

EVG 已經開始接受各界對次世代 EVG150 自動化光阻製程系統的訂單，並在公司總部提供產品展示。更多相關資訊請瀏覽：

<https://www.evgroup.com/products/lithography/resist-processing-systems/evg150/>。

關於 EV Group (EVG)

EVG 是全球半導體、微機電、化合物半導體、電源元件和奈米科技應用的晶圓製程解決方案領導廠商，主要產品包括晶圓鍵合、晶圓薄化、微影/奈米壓印微影技術 (NIL) 和檢測設備，以及光阻塗佈機、顯影機、晶圓清洗和檢測設備。EVG 成立於 1980 年，藉由一個完備的全球網絡資源為全球的客戶和合作夥伴提供服務。更多相關資訊請參考公司網站：www.EVGroup.com。

###

EV Group 新聞聯絡人：

Clemens Schütte

EVG 行銷與傳播總監

電話：+43 7712 5311 0

E-mail: Marketing@EVGroup.com

世紀奧美公關顧問

蔡宜真/詹淑君

電話：0970-504-933/0975-251-507

E-mail: SalinYC.Tsai@eraogilvy.com
ShirleySC.Chan@eraogilvy.com